18.11.2004

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の曹類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年12月10日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-411124

. .

REC'D 16 DEC 2004

[ST. 10/C]:

[JP2003-411124]

出 願 人
Applicant(s):

日産化学工業株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004年10月20日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 1) 11



ページ:

【書類名】

特許願

【整理番号】

4629000

【提出日】

平成15年12月10日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

C07D333/10

【発明者】

【住所又は居所】

千葉県船橋市坪井町722番地1 日産化学工業株式会社 物質

科学研究所内 鈴木 秀雄

【氏名】

【特許出願人】

000003986

【識別番号】 【氏名又は名称】

日産化学工業株式会社

【代表者】

藤本 修一郎

【電話番号】

047-465-1120

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

【納付金額】

005212 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

特許請求の範囲 1

【物件名】 【物件名】 明細書 1 要約書 1

出証特2004-3094564

```
【書類名】特許請求の範囲
  【請求項1】
 式[1]
     【化1】
   CH<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>D</sub>CH<sub>2</sub>OSO<sub>3</sub>R
                                 [1]
   CH2(CH2)nCH2OSO3R
 (式中、Rは水素原子、アルカリ金属原子又はアルカリ土類金属原子を表し、nは1~3
 の整数を表す。)
 で表される3, 4-ビス(1-スルホオキシアルキル)チオフェン化合物。
 【請求項2】
式[2]
     【化2】
   CH<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>CH<sub>2</sub>OH
                               [2]
   CH<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>CH<sub>2</sub>OH
 (式中、nは1~3の整数を表す。)
で表される3, 4-ビス(1-ヒドロキシアルキル)チオフェン化合物。
 【請求項3】
式[3]
     【化3】
  CH2CH2CH2OSO3R
                              [3]
   CH2CH2CH2OSO3R
 (式中、Rは水素原子、アルカリ金属原子又はアルカリ土類金属原子を表す。)
で表される3, 4-ビス(1-スルホオキシプロピル-3-イル)チオフェン化合物。
 【請求項4】
式[4]
    【化4】
  CH2CH2CH2OH
                             [4]
  CH2CH2CH2OH
で表される3,4ービス(1ーヒドロキシプロピルー3ーイル)チオフェン。
 【請求項5】
式 [2]
    【化5】
  CH<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>CH<sub>2</sub>OH
                              [2]
  CH<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>CH<sub>2</sub>OH
 (式中、nは1~3の整数を表す。)
で表される3,4-ビス(1-ヒドロキシアルキル)チオフェン化合物に三酸化硫黄化合
物を反応させて、式「5]
    【化6】
  [5]
  CH<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>CH<sub>2</sub>OSO<sub>3</sub>H
(式中、nは前記と同じ意味を表す。)
で表される3,4-ビス(1-スルホオキシアルキル)チオフェン化合物を得た後、アル
カリ金属化合物又は、アルカリ土類金属化合物と反応させることを特徴とする式 [6]
```

【化7】

CH<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>CH<sub>2</sub>OSO<sub>3</sub>M

[6]

CH<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>CH<sub>2</sub>OSO<sub>3</sub>M

(式中、Mはアルカリ金属原子又はアルカリ土類金属原子を表し、nは前記と同じ意味を 表す。)

で表される3,4-ビス(1-スルホオキシアルキル)チオフェン金属塩化合物の製造法

【請求項6】

式[7]

【化8】

С≣ССН<sub>2</sub>ОН

[7]

С≣ССНЭОН

で表される 3-[4-(3-ヒドロキシープロパー1-イニル)-チオフェン-3-イル ] -プロパー2-イン-1-オールを還元することを特徴とする、式 <math>[4] 【化 9】

CH2CH2CH2OH

CH2CH2CH2OH

[4]

で表される3, 4-ビス(1-ヒドロキシプロピル-3-イル) チオフェンの製造法。 【請求項7】

アルカリ金属原子がナトリウム又はカリウムであることを特徴とする請求項1、3及び5 記載のスルホオキシアルキニルチオフェン化合物類及びその製造法。

#### 【請求項8】

三酸化硫黄化合物が、三酸化硫黄、三酸化硫黄・1,4-ジオキサン錯体、三酸化硫黄・DMF(N,N-ジメチルホルムアミド)錯体又は三酸化硫黄・ピリジン錯体であることを特徴とする請求項5記載のスルホオキシアルキルチオフェン化合物類の製造法。

【曹類名】明細書

【発明の名称】スルホオキシアルキルチオフェン化合物及びその製造法

【技術分野】

[000.1]

本発明は、π 共役系導電性高分子材料のモノマーに関する。

【背景技術】

[0002]

従来よりスルホン酸基を有する $\pi$  共役系導電性高分子は多数知られているが、例えば自己ドープ可能なポリチオフェンは一般に電子ビームリソグラフィーなどに応用されている(非特許文献 1 及び非特許文献 2 参照。)。また、帯電防止用途等に用いられる水溶性自己ドープ型ポリチオフェンとしては、ポリ(3- チオフェン-  $\beta-$  ブタンスルホネート)、ポリ(3- チオフェン-  $\beta-$  エタンスルホネート)が知られている(非特許文献 1 及び非特許文献 3 参照。)。

[0003]

しかし、本発明のスルホオキシアルキルチオフェン化合物類は未だ報告がない。

[0004]

なお、ヒドロキシアルキニルチオフェン化合物としては、式[7]

[0005]

【化1】

C≡CCH<sub>2</sub>OH

[7]

C≡CCH2OH

[0006]

で表される 3-[4-(3-ヒドロキシープロパー1-イニル) ーチオフェンー <math>3-イル ] ープロパー2-イン-1-オール (3, 4 HTPO) が知られている(特許文献 1 参照。)。

【特許文献1】国際公開第01/19809号パンフレット(第21頁、第27頁及び第41-42頁)

【非特許文献 1】「シンセティク・メタルズ (Synth. Met.)」、 (オランダ)、エルゼビア・セコイア、1989年、第30巻、p. 305-319

【非特許文献 2】 「ハンドブック・オブ・コンダクティング・ポリマー(Handbook of Conducting Polymers)」、第二版 改訂・増補、(米国)、マーセル・デッカーズ・インク、1998年、p. 930

【非特許文献 3 】「ジャーナル・オブ・アメリカン・ケミカル・ソサエティ(J. Ame r. Chem. Soc.)」、(米国)、米国化学会、、1987年、第109巻、p. 1858-1859

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0007]

本発明は、酸化重合できるπ共役系導電性高分子モノマーを提供することを課題とする

【課題を解決するための手段】

[0008]

本発明者らは、上記課題を解決するため鋭意研究を行った。

[0009]

即ち、本発明の第一観点は、式[1]

[0010]

```
【化2】
    CH<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>CH<sub>2</sub>OSO<sub>3</sub>R
                                    [1]
     CH<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>CH<sub>2</sub>OSO<sub>3</sub>R
     [0011]
   (式中、Rは水素原子、アルカリ金属原子又はアルカリ土類金属原子を表し、nは1~3
  の整数を表す。)
  で表される3,4-ビス(1-スルホオキシアルキル)チオフェン化合物である。
    [0012]
    ここでは、式 [1] において、nは1~3の整数を表す該化合物が挙げられる。より具
 体的には、式 [1] において、nは1である該化合物が挙げられる。
    [0013]
   本発明の第二観点は、式[2]
    [0014]
      【化3】
    CH<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>CH<sub>2</sub>OH
                                  [2]
    CH<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>CH<sub>2</sub>OH
    [0015]
  (式中、nは1~3の整数を表す。)
 で表される3,4-ビス(1-ヒドロキシアルキル)チオフェン化合物である。
    [0016]
   ここでは、式 [2] において、 n は 1 ~ 3 の整数を表すの該化合物が挙げられる。より
 具体的には、式 [2] において、nは1である該化合物が挙げられる。
   [0017]
  本発明の第三観点は、式「21
   [0018]
     【化4】
   CH<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>CH<sub>2</sub>OH
                                 [2]
   CH<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>CH<sub>2</sub>OH
   [0019]
 (式中、nは1~3の整数を表す。)
で表される3,4-ビス(1-ヒドロキシアルキル)チオフェン化合物に三酸化硫黄化合
物を反応させて、式[5]
   [0020]
     【化5】
  CH2(CH2)nCH2OSO3H
                                 [5]
  CH2(CH2)nCH2OSO3H
   [0021]
 (式中、nは1~3の整数を表す。)
で表される3,4ービス(1ースルホオキシアルキル)チオフェン化合物を得た後、アル
カリ金属化合物又は、アルカリ土類金属化合物と反応させることを特徴とする式 [6]
  [0022]
    【化6】
  CH<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>CH<sub>2</sub>OSO<sub>3</sub>M
                                 [6]
  CH<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>CH<sub>2</sub>OSO<sub>3</sub>M
  [0023]
```

(式中、Mはアルカリ金属原子又はアルカリ土類金属原子を表し、nは1~3の整数を表 す。)

で表される3,4-ビス(1-スルホオキシアルキル)チオフェン金属塩化合物の製造法 である。

[0024]

ここでは、式 [2] [5] [6] において、nは1~3の整数を表す該化合物の製造法 が挙げられる。より具体的には式[2][5][6]において、nは1であるの該化合物 の製造法が挙げられる。

[0025]

及び、本発明の第四観点は、式 [7]

[0026]

【化7】

С≣ССН₂ОН

[7]

°С≡ССН<sub>2</sub>ОН

-100271

で表される3- [4-(3-ヒドロキシープロパー1-イニル) ーチオフェン-3-イル ] ープロパー2ーインー1ーオール(3,4HTPOと略記する。)を還元することを特 徴とする、式[4]

[0028]

【化8】

CH2CH2CH2OH

CH2CH2CH2OH

[4]

[0029]

で表される3, 4ービス (1ーヒドロキシプロピルー3ーイル) チオフェン (3, 4 B H Tと略記する。) の製造法である。

【発明の効果】

[0030]

本発明により、酸化重合できる有用な $\pi$ 共役系導電性高分子モノマーを提供することが できる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0031]

以下、本発明を詳細に説明する。

[0032]

前記式 [1] [2] [5] [6] に於いて、nが1の場合について説明する。

[0033]

本発明化合物の製造法は、前述した様に次の3つの反応スキームで表される。

[0034]

【化9】

(1) 
$$C \equiv CCH_2OH$$
 +  $4H_2$   $CH_2CH_2CH_2OH$   $CH_2CH_2CH_2OH$   $CH_2CH_2CH_2OH$   $CH_2CH_2CH_2OH$   $CH_2CH_2OH$   $CH_2CH_2OH$   $CH_2CH_2OH$   $CH_2CH_2OH$   $CH_2CH_2OH$   $CH_2CH_2OH$ 

[0036] 【化11】

[0037]

(上記3式中、Mはアルカリ金属またはアルカリ土類金属を表し、Yは残基を表す。) 以下順にスキーム (1) から述べる。

[0038]

先ず原料である3,4HTPOの製造法は、国際公開第01/19809号パンフレッ トに記載された以下の反応スキームで表される。

[0039] 【化12】

[0040]

(式中、Xは前記と同じ意味を表す。)

原料の3, 4-ジハロゲノチオフェン(3, 4DXT)としては、3, 4-ジフルオロ チオフェン、3, 4ージクロロチオフェン、3, 4ージプロモチオフェン及び3, 4ージ ヨードチオフェン等が挙げられ、反応性や経済性から3, 4ージブロモチオフェンが好ま

## [0041]

もう一方の原料は、プロパルギルアルコールであり、これらは市販品をそのまま使用す ることができる。

[0042]

触媒としては、Pd (Ph 3 P) 4 (2+1mol%) 及びCu I (3+1.5mol

)と溶媒としてn-プロピルアミンを使用し加熱還流した後、シリカゲルカラムクロマト グラフィーで精製することにより3,4HTPOが得られる。

[0043]

尚、国際公開第01/19809号パンフレットには、その中間体の3,4XTPOの 記載はなかったが、本発明者は前記反応生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで 精製することにより3,4HTPOの他に3-(4-ハロゲノーチオフェン-3-イル) ープロパー2ーインー1ーオール(3,4XTPO)を単離・構造解析し確認した。

第1工程の3,4HTPO化合物(前記式[7])の3,4BHT化合物(前記式[4 ]) への還元反応は、三重結合を単結合に変換する種々の一般的還元法が適用できる。 [0045]

例えば、(1)金属および金属塩による還元、(2)金属水素化物による還元、(3) 金属水素錯化合物による還元、(4)ジボランおよび置換ボランによる還元、(5)ヒド ラジンによる還元、(6)ジイミド還元、(7)リン化合物による還元、(8)電解還元

出証特2004-3094564

及び(9)接触還元等を挙げることができる。

# [0046]

これらの中で、最も実用的方法は接触還元方法である。本発明で採用できる接触還元法 は以下の通りである。触媒金属としては、周期律表第8族のパラジウム、ルテニウム、ロ ジウム、白金、ニッケル、コバルト及び鉄、又は第1族の銅等が使用できる。これらの金 属は単独で、又は他の元素と複合させた多元系で使用される。それらの使用形態は、各金 属単身、ラネー型触媒、ケイソウ土、アルミナ、ゼオライト、炭素及びその他の担体に担 持させた触媒及び錯体触媒等が挙げられる。

## [0047]

具体的には、パラジウムー炭素、ルテニウムー炭素、ロジウムー炭素、白金ー炭素、パ ラジウムーアルミナ、ルテニウムーアルミナ、ロジウムーアルミナ、白金ーアルミナ、還 元ニッケル、還元コバルト、ラネーニッケル、ラネーコバルト、ラネー銅、酸化銅、銅ク ロマト、クロロトリス (トリフェニルホスフィン) ロジウム、クロロヒドリドトリス (ト リフェニルホスフィン) ルテニウム、ジクロロトリス (トリフェニルホスフィン) ルテニ ウム及びヒドリドカルポニルトリス(トリフェニルホスフィン)イリジウム等が挙げられ る。これらの中で特に好ましいものはパラジウムー炭素及びルテニウムー炭素等である。

## [0048]

触媒の使用量は、5%金属担持触媒として基質に対し0.1~30質量%が、特には、 0.5~20質量%が好ましい。溶媒は、メタノール、エタノール及びプロパノール等に 代表されるアルコール類、ジオキサン、テトラヒドロフラン及びジメトキシエタン等に代 表されるエーテル類及び酢酸エチル及び酢酸プロピル等に代表されるエステル類等が使用 できる。

# [0049]

その使用量は、原料に対し1~50質量倍の範囲が、特には、3~10質量倍の範囲が 好ましい。水素圧は常圧から10MPa(100kg/cm²)の範囲が、特には、常圧 から5MPa (50kg/cm²) の範囲が好ましい。反応温度は、0~180℃の範囲 が、特には、10~150℃の範囲が好ましい。

#### [0050]

反応は、水素吸収量によって追跡することができ、理論水素量の吸収後サンプリングし ガスクロマトグラフィーで分析し確認することができる。本反応は、回分式でも連続反応 でも可能である。反応後は、濾過により触媒を除き、濃縮後、再結晶法又はカラムクロマ トグラフィー法で精製することができる

次に、3,4BHTのスルホン酸エステルである3,4BSTへのスルホン化剤として は、三酸化硫黄(SО3) 化合物が用いられる。その形態としては、三酸化硫黄単身(そ のもの) の他に、N, N-ジメチルホルムアミド (DMF) 、<math>1, 4-ジオキサン及びピリジン等との錯体も用いることができる。その使用量は、原料のヒドロキシ基に対し1~ 1. 5モル当量が好ましい。

#### [0051]

溶媒としては、例えばN, N-ジメチルホルムアミド (DMF)、N, N-ジメチルア セトアミド (DMAc)、N-メチルピロリドン (NMP) 及び1, 3-ジメチル-2-イミダゾリジノン (DMI) 等のアミド化合物、テトラヒドロフラン (THF) 、1, 2 ージメトキシエタン及び1,4ージオキサン等のエーテル化合物類が挙げられる。特には 、DMFやDMAcが好ましい。その使用量は、基質に対して1~10質量倍が好ましく 、特には2~5質量倍が好ましい。

## [0052]

反応温度は、0~150℃で可能であるが、特には10~100℃が好ましい。

# [0053]

反応時間は、液体クロマトグラフィー等の反応液の分析結果から決定することができ、 通常1~5時間で終了する。

## [0054]

反応終了後は、濃縮により溶媒を留去後、残査にアセトンを加えて加温してから室温静 置すると結晶が析出する。これを濾取し、乾燥すると目的の3,4ービス(1ースルホオ キシプロピル)チオフェン(3,4BST)が得られる。

# [0055]

次にスキーム (3) の3, 4 B S T と金属化合物の反応によるスルホオキシプロピルチ オフェン金属塩化合物の製造法について述べる。

# [0056]

金属化合物としては、周期律表のアルカリ金属化合物又はアルカリ土類金属化合物を表 し、例えば、リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、マグネシウム、 カルシウム、ストロンチウム及びバリウム等の水酸化物、炭酸塩及び有機酸塩等が挙げら れる。

## [0057]

具体的には、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化マグネシウム、水酸化カルシ ウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸マグネシウム、炭酸カルシウム、炭酸水素ナ トリウム、炭酸水素カリウム、炭酸水素マグネシウム、炭酸水素カルシウム、ギ酸ナトリ ウム、ギ酸カリウム、ギ酸マグネシウム、ギ酸カルシウム、酢酸ナトリウム、酢酸カリウ ム、酢酸マグネシウム及び酢酸カルシウム等が挙げられる。

#### [0058]

これらの中で特には、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化マグネシウム、水酸 · 化カルシウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸マグネシウム、炭酸カルシウム、炭 酸水素ナトリウム及び炭酸水素カリウム等が好ましい。

## [0059]

これらの使用量は、基質のスルホン基に対して1~2モル当量が好ましく、特には、1 ~1.5モル当量が好ましい。

# [0060]

溶媒としては、基質と金属化合物を溶解する水の他に、例えばN, Nージメチルホルム アミド (DMF) 、N, N-ジメチルアセトアミド (DMAc) 、N-メチルピロリドン 及び1,3-ジメチルー2-イミダゾリジノン(DMI)等のイミド化合物を単独又は水 との混合溶媒として使用できる。その使用量は、基質に対して1~10質量倍が好ましく 、特には2~5質量倍が好ましい。

#### [0061]

反応温度は、-20~50℃で可能であるが、特には0~40℃が好ましい。

#### [0062]

反応時間は、液体クロマトグラフィー等の反応液の分析結果から決定することができ、 通常 0. 5~5時間で終了させることができる。

# [0063]

反応終了後は、濃縮により溶媒を留去後、残査にメタノールを加えて抽出し過剰金属化 合物を除いた後濃縮し、その残査にエタノールを加えて晶析させると3,4ービス(1-スルホオキシアルキル)チオフェン金属塩化合物(金属がナトリウムの場合は、3,4B SST) が得られる。

## [0064]

尚、スキーム (2) のスルホン化反応液をそのままスキーム (3) の金属塩化反応に供 することもできる。

#### [0065]

以上述べた本発明の反応及び精製は、回分式でも連続式でも可能である。

#### [0066]

又、反応は常圧でも加圧でも行うことができる。

# 【実施例】

# [0067]

以下に実施例を挙げ、本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるもの 出証特2004-3094564

ではない。

[0068]

尚、実施例で用いた分析法は以下の通りである。

[0069]

[1] [ガスクロマトグラフィー (GC)]

機種: Shimadzu GC-17A, Column: キャピラリカラム CBP1-W25-100 (25 m x 0.53 m m φ x 1 μ m ), カラム温度: 100℃(保持 2 min.)-8℃/min. (昇温速度)-290℃(保持 10 min.), 注入口温度: 290 ℃, 検出器温度: 290 ℃, キャリアガス: ヘリウム, 検出法: FID 法.

[2] [質量分析 (MASS)]

機種: LX-1000 (JEOL Ltd.), 検出法: FAB 法.

[3]  $[^1H NMR]$ 

機種: INOVA500 (VARIAN Corp.), 測定溶媒: CDC13

標準物質: tetramethylsilane (TMS).

[4]  $[^{13}C NMR]$ 

機種: INOVA500 (VARIAN Corp.), 測定溶媒: CDC13

標準物質: CDCl<sub>3</sub> (δ: 77.1 ppm).

[5][融点(mp)]

測定機器: MP-J3 (ヤナコ機器開発研究所製)

[6] [液体クロマトグラフィー (LC)]

機種: Shimadzu LC-10A, Column : YMC-Pack ODS-AM (S-5μm, 120A, AM-303, AM12S0 5-2546WT) ( 250 mm x 4.6 mm φ ), カラム温度: 40℃, 検出器波長 : UV 230 nm,

溶離液: H<sub>2</sub> O/CH<sub>3</sub> CN=1/2, 流速: 0.5ml/min。

[0070]

参考例1

. [0071]

【化13】

[0072]

300mL 四つ口反応フラスコに3,4ージプロモーチオフェン(3,4DBT)2 5.0g(103mmol)とnープロピルアミン100gを仕込み25℃で攪拌中に、 テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム 2. 38g(2.06mmol)及び沃化 銅0.588g(3.09mmol)を添加してから、プロパルギルアルコール17.3 g(309mmol)を10分かけて滴下した。そのまま25℃で1時間攪拌してから更 に70℃の油浴(内温54℃)で7時間攪拌した。続いてテトラキストリフェニルホスフ インパラジウム 1. 19g (1. 03mmol) 及び沃化銅 0. 29g (1. 10mmo 1)を添加してから、プロパルギルアルコール 8.7g(155mmol)を滴下した。 再び、70℃の油浴(内温57℃)で20時間攪拌した。反応終了後、濃縮しその残査を 酢酸エチルと水に溶解させ、不溶分をセライト濾過で除去した後分液して得られた有機層 を濃縮すると油状物37.5gが得られた。この油状物をガスクロマトグラフィーで分析 の結果、新たなピークAが40. 8面積%と新たなピークBが23. 3面積%として出現 した。これをシリカゲル140gを用いたカラムクロマトグラフィー(溶離液/酢酸エチ ル:n-ヘプタン=1:9~1:5)で精製すると留分1の油状物16.0g(純度70 . 6%) (収率57%)と留分2の油状物4. 56g(純度76. 5%)(収率23. 7 %)が得られた。

[0073]

更に、留分1の油状物16.0g(純度70.6%)をシリカゲル140gを用いたカ 出証特2004-3094564 ラムクロマトグラフィー(溶離液/酢酸エチル:n-ヘプタン= $1:9\sim1:5$ )で再精製すると留分6の油状物10.3g(純度93.0%)(回収率84.7%)が得られた。この油状物は、下記の分析結果から3-(4-プロモーチオフェン-3-イル)ープロパー2-イン-1-オール(3, 4 B T P O)であることを確認した。

[3, 4BTPO]

<sup>1</sup>H NMR(CDC1<sub>3</sub>, δ ppm) : 4.43(s, 2H), 7.13(d, J=3.36Hz, 1H), 7.36(d, J=3.67Hz, 1H).

<sup>13</sup>C NMR(CDCl<sub>3</sub>, δ ppm) : 51.2564, 78.5646, 90.6355, 113.3275, 123.8113, 122.9033, 127.1915。

[0075]

一方、留分2の油状物4.56g(純度76.5%)をシリカゲル40gを用いてカラムクロマトグラフィー(溶離液/酢酸エチル:n-ヘプタン=1:9~1:5)で再精製すると留分1の油状物1.0g(純度90.6%)が得られた。

[0076]

この油状物は、下記の分析結果から3-[4-(3-ヒドロキシープロパー1-イニル)-チオフェン-3-イル]-プロパー2-イン-1-オール(3,4HTPO)であることを確認した。

[0077]

[3, 4HTPO]

MASS(FAB+, m/e(%)): 191([M-H]+, 3), 174(29), 146(62), 102(100).

<sup>1</sup>H NMR(CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$  ppm) : 4.45(s, 4H), 7.31(s, 2H).

<sup>13</sup>C NMR(CDC1<sub>3</sub>, δ ppm) : 50.9736(2C), 78.9914(2C), 89.8720(2C), 124.0855(2C), 12 8.3813(2C)。

[0078]

実施例1

[0079]

【化14】

[0080]

100 mLハステロイ製オートクレープに、3,4 HTPO19.2 g (0.10 mo1)、5% P d/C (50.7%含水品)1.95 g (5 質量%)、及びエタノール100 g を仕込んだ後、窒素置換後水素初圧5 M P a で撹拌を開始しながら昇温し、120 で6時間反応させた。室温まで冷却してから、濾過により触媒を除去してから濃縮・乾燥させると、ガスクロマトグラフィー分析で原料と異なるほぼ単一成分の結晶(室温で固化)20.0 g (0.10 mo1) (収率100%)が得られた。この結晶の構造は、下記の分析結果から3,4 ービス (1 ーヒドロキシプロピルー3 ーイル)チオフェン(3,4 B H T)であることを確認した。

[0081]

MASS(EI+, m/e(%)) : 200(M+, 19), 182(14), 156(40), 111(100).

<sup>1</sup>H NMR (DMSO-d<sub>6</sub>,  $\delta$  ppm) : 1.69-1.75(m, .4H), 2.51(t, J=7.84Hz, 4H), 3.42-3.48(m, 4H), 4.51(t, J=5.00Hz, 2H), 7.05(s, 2H).

<sup>13</sup>C NMR (DMSO-d<sub>6</sub>, δ ppm) : 24.6925, 32.5363, 60.3863, 120.2828, 141.3420 (各 2 本分) .

mp. (℃):45-46。

[0082]

実施例2 [0083] 【化15】

[0084]

50mLガラス製四つ口反応フラスコに3,4-ビス(1-ヒドロキシプロピル-3-イル) チオフェン (3, 4 B H T) 2. 00g (10.0 m m o l) と N, N ージメチル ホルムアミド(DMF)10gを仕込み、攪拌しながら10℃で三酸化硫黄・ピリジン錯 体3. 18g(20.0mmol)を分割添加した。次第に20℃に戻してから、1時間 攪拌した後、LC分析すると原料3, 4BHTが消失し、新たなピークが出現した。次に 減圧濃縮後、アセトンを加えて加温後、15℃で一夜静置するとガム状固形物が析出して いた。この固形物を濾取し乾燥することにより、ガム状物 5. 01gを得た。この生成物 は下記の結果から3、4-ビス(1-スルホオキシプロピル-3-イル)チオフェン・二 ピリジン塩 (3, 4 B S T · 2 P y) であることを確認した。

[0085]

MASS(FAB<sup>-</sup>, m/e(%)) : 359(M<sup>-</sup>, 19), 279(100), 97(53).

<sup>1</sup>H NMR (DMSO-d<sub>6</sub>,  $\delta$  ppm) : 1.78 (dt, J<sub>1</sub>=6.57Hz, J<sub>2</sub>=14.21Hz, 4H), 2.51(t, J=7.63Hz, 4H), 3.78(t, J=6.42Hz, 4H), 7.06(s, 2H),  $8.10(dd, J_1=6.45Hz, J_2=7.67Hz, 4H)$ ,  $8.10(dd, J_1=6.45Hz, J_2=7.67Hz, 4H)$ ,  $8.10(dd, J_1=6.45Hz, J_2=7.67Hz, 4H)$ 62-8.66(m, 2H), 8.94(d, J=5.19Hz, 4H).

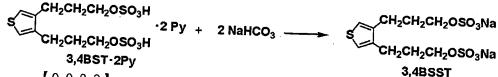
<sup>13</sup>C NMR(DMSO-d<sub>6</sub>, δ ppm) : 24.5297, 29.0696, 120.6464, 127.3915, 140.7594, 142.0 642 (以上各 2 本分) , 146.6423。

[0086]

実施例3

[0087]

【化16】



[0088]

50 m L ガラス製四つ口反応フラスコに 3 , 4 - ピス (1 - スルホオキシプロピル- 3ーイル) チオフェン・二ピリジン塩(3,4BST・2Py)3.60g(6.95mm o 1) とN, N-ジメチルホルムアミド (DMF) 18gを仕込み、20℃で攪拌下に重 曹2.02g(24.0mmol)を添加した後、30分攪拌継続した。次に、減圧濃縮 すると残渣が得られた。この残渣にメタノール50gを加え50℃に加温すると固形物が 析出したので、これを氷冷してからセライト濾過した。濾液を濃縮乾燥すると固形物 6. 7 gが得られた。この粗物にメタノールを加えて再溶解した後、濃縮してゲル状になった ところで、エタノール20gを加えて50℃に加温後、氷冷してから濾過・エタノール洗 浄し、更に乾燥するとLC分析で単一ピークの白色結晶2.29g(収率82.2%)が 得られた。この結晶は、下記の結果から3,4-ビス(1-ナトリウムスルホオキシプロ ピルー3-イル) チオフェン (3, 4 B S S T) であることを確認した。 [0089]

MASS(FAB<sup>-</sup>, m/e(%)): 403([M-H]<sup>-</sup>, 3), 381(100), 359(9), 279(25), 97(53).

 $^{1}$ H NMR (DMSO-d<sub>6</sub>,  $\delta$  ppm) : 1.79(t, J=7.64Hz, 4H), 2.48-2.51(m, 4H), 3.75(t, J=6.5) 7Hz, 4H), 7.09(s, 2H).

<sup>13</sup>C NMR(DMSO-d<sub>6</sub>, δ ppm) : 24.5069, 29.0774, 65.1374, 120.6161, 140.7825 (以上各 2本分).

ページ: 10/E

mp. (°C): 215-216.

[0090]

本発明により、酸化重合できる有用な $\pi$ 共役系導電性高分子モノマーを提供することが出来る。

#### 【曹類名】要約曹

【要約】

【課題】 スルホン酸基を有するπ共役系導電性高分子は多数知られている。例えば自己 ドープ可能なポリチオフェンは、一般に電子ビームリソグラフィーなどに応用されている 。ここでは、酸化重合できるπ共役系導電性高分子モノマーを提供する。

【解決手段】 式[1]

【化1】

CH2(CH2)nCH2OSO3R



CH<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>CH<sub>2</sub>OSO<sub>3</sub>R

[1]

(式中、Rは水素原子、アルカリ金属原子又はアルカリ土類金属原子を表し、nは1~3の整数を表す。)

で表される3, 4-ビス(1-スルホオキシアルキル) チオフェン化合物、及び式[2] 【化2】 .

CH2(CH2)nCH2OH

[2]

CH2(CH2)nCH2OH

(式中、nは、前記と同じ。)

で表される3,4ービス(1ーヒドロキシアルキル)チオフェン化合物、並びにそれらの製造法による。

【選択図】 なし

1/Ė

特願2003-411124

出願人履歴情報

識別番号

[000003986]

1. 変更年月日 [変更理由]

住 所 氏 名

1990年 8月29日

新規登録

東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1

日産化学工業株式会社